



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113196160 A

(43) 申请公布日 2021.07.30

(21) 申请号 201980002729.3

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2019.11.29

G02F 1/1362 (2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日  
2019.12.02

(86) PCT国际申请的申请数据  
PCT/CN2019/122129 2019.11.29

(87) PCT国际申请的公布数据  
W02021/102972 ZH 2021.06.03

(71) 申请人 京东方科技集团股份有限公司  
地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号  
申请人 成都京东方光电科技有限公司

(72) 发明人 牟鑫 刁永富

(74) 专利代理机构 北京市柳沈律师事务所  
11105

代理人 焦玉恒

(54) 发明名称

阵列基板及其制作方法、显示装置以及显示基板

(57) 摘要

一种阵列基板及其制作方法、有机发光二极管显示装置以及显示基板。阵列基板包括：衬底基板(100)以及位于衬底基板(100)上的第一颜色子像素(110)和第二颜色子像素(120)。第一颜色子像素(110)包括第一驱动晶体管(111)，第二颜色子像素(120)包括第二驱动晶体管(121)，且第一驱动晶体管(111)的沟道宽长比大于第二驱动晶体管(111)的沟道宽长比。本公开实施例通过优化阵列基板上的不同颜色子像素的驱动晶体管的沟道宽长比，可以提高包括该阵列基板的显示装置的亮度。

